

# 赤外線加熱

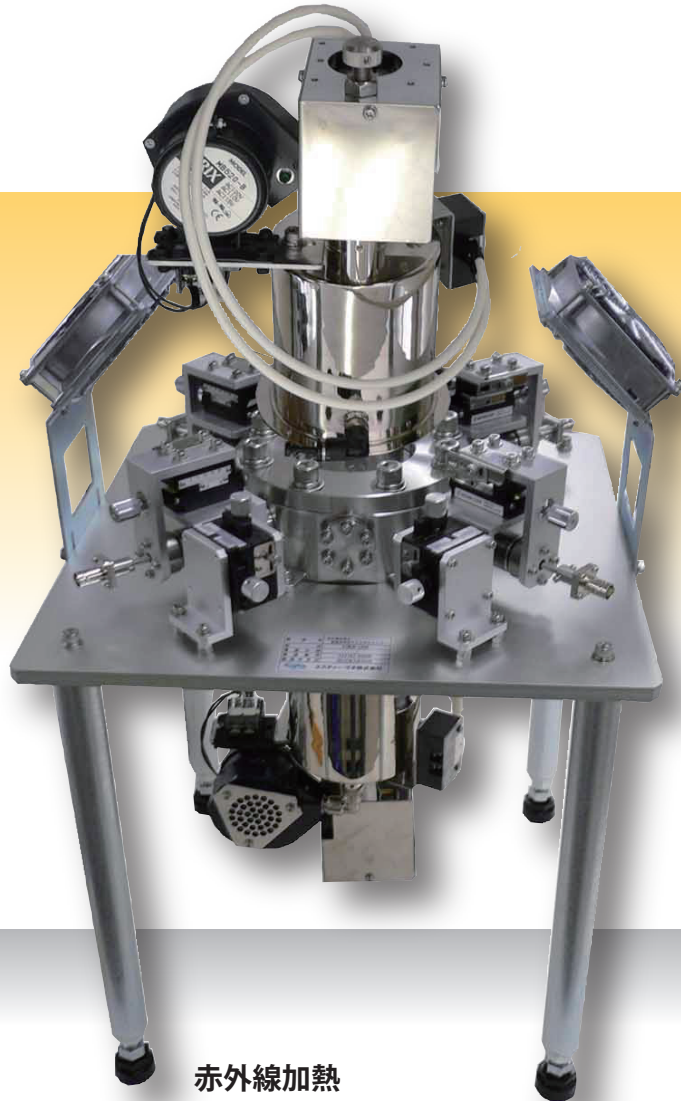
## & 酸素分圧制御

# マイクロチャンバー

## Model SiMCB-IR80 & SiOC-200CB

### 装置概要

本装置は、4対の測定マイクロプローブと上下2台の赤外線加熱炉を有する高真空対応型のマイクロチャンバーとPID式循環型酸素分圧コントローラーから構成され、酸素分圧を1~10<sup>-30</sup>atm及び1インチのサンプル温度を最大1200℃まで急速加熱が可能なシステムです。



赤外線加熱  
マイクロチャンバー  
**SiMCB-IR80**

PID 式循環型  
酸素分圧コントローラー  
**SiOC-200CB**



### 仕様

【赤外線マイクロチャンバー】	
チャンバーサイズ	φ152mm×80mm (内部φ100×50ml)
試料サイズ	maxφ25.4×t2mm
試料ホルダー	SiC 製
照射窓	石英ガラス (上下2枚、φ100×t6mm)
到達真空	10 <sup>-6</sup> Pa
マイクロプローブ 探芯	白金メッキタングステン (先端 50μmφ)
探芯移動方法	3軸 (X,Y,Z) ステージ
赤外線加熱炉	集光加熱方式 (2kW / 台)
集光サイズ	φ30mm (焦点距離 80mm)
最高温度	1200℃以上
外形寸法	W364×H700×D364
【PID 式酸素分圧コントローラー】	
酸素分圧制御範囲	1~10 <sup>-30</sup> atm / CB タイプ
処理ガス種	不活性ガス (N <sub>2</sub> , Ar, He など)
処理ガス流量	200 SCCM
酸素分圧制御方式	ジルコニア式酸素ポンプ
酸素分圧設定	デジタル式
外部エータ制御・ソフト	標準添付
モニター項目	: 酸素分圧、ライン圧力
制御項目	: 酸素分圧、外部流路切換
外形寸法	W220×H378×D570

